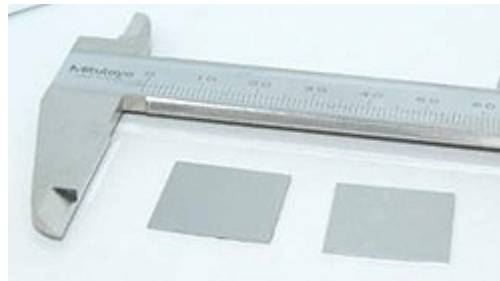


軟X線多層膜偏光子

EUV領域用・軟X線領域用の反射型偏光子を提供します

特徴



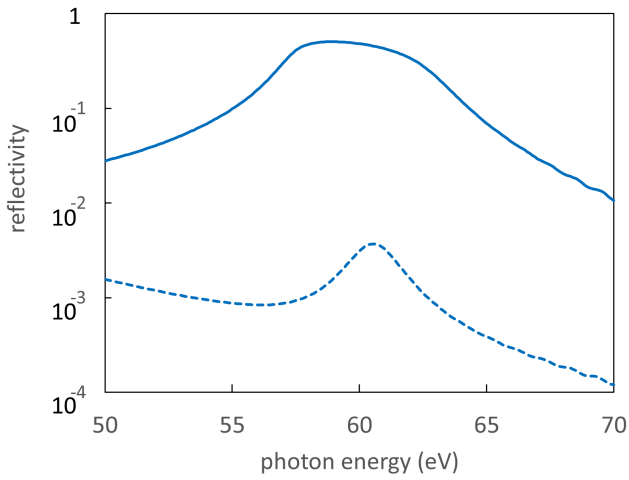
W/B4C多層膜偏光子

物質の屈折率が1に近いEUV領域や軟X線領域ではBrewster's角は45度近辺にあります。そのため45度近辺用の多層膜ミラーはs偏光のみに高い反射率を持ち偏光子としても機能します。この特性を利用し、およそ30 eVから800 eV（1.5 nm - 40 nm）で十分な効率を持つ多層膜偏光子ご提供いたします。

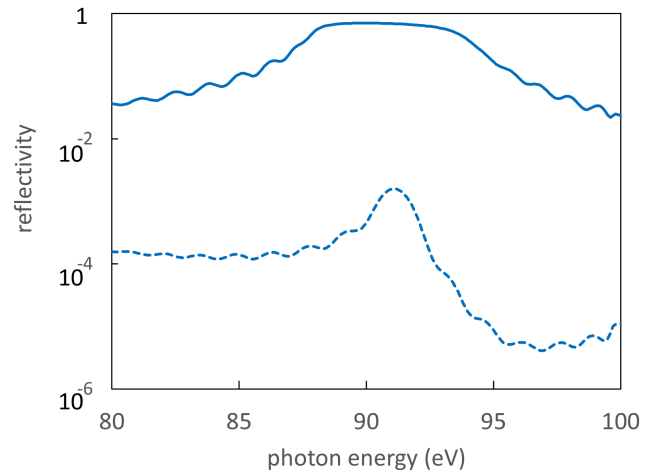
これらの多層膜偏光子は、放射光や高次高調波を用いた物性実験用途の他、EUVリソグラフィなどの産業応用向け基礎研究にもお使いいただけます。

設計例

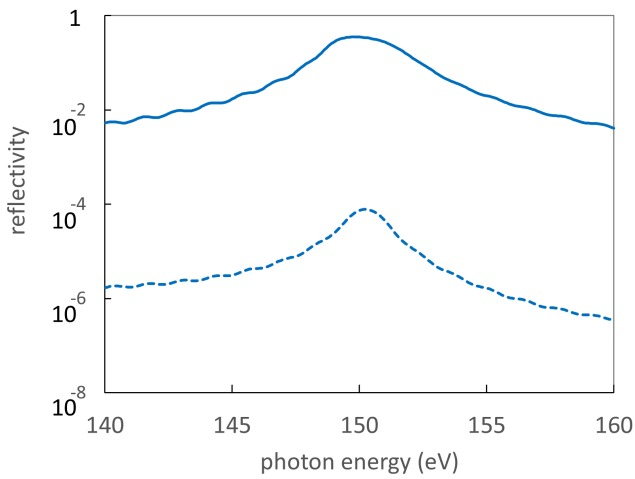
実線：s偏光, 破線：p偏光



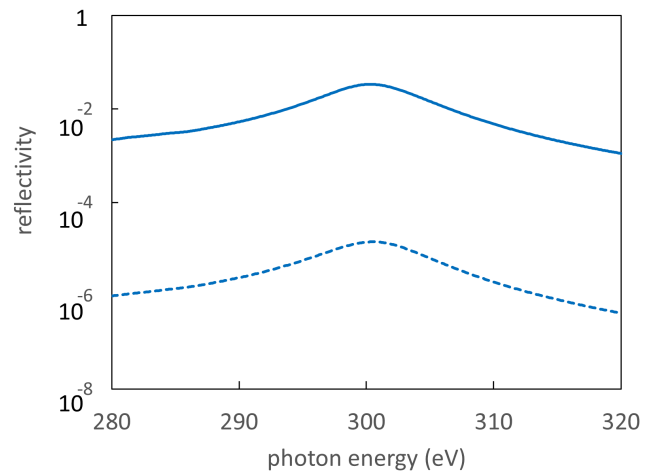
エネルギー60 eV用偏光子



エネルギー90 eV用偏光子



依存性エネルギー150 eV用偏光子



エネルギー300 eV用偏光子

代表的な仕様

ご要望に応じた基板形状設計、コーティング設計をいたします。

	代表的な仕様
基板サイズ	10 mm x 10 mm x 1 mm厚
基板材料	Si
多層膜材料	SiC/Mg, Zr/AlSi, Mo/Si, Ru/B ₄ C, W/B ₄ C
対応エネルギー領域	30 eV - 800 eV